ارائه روشی نوین برای ساخت یک ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی با الکترودهایی در دو سمت برای کاربردهای زیست-فناوری

نیما طالبزاده ، کارشناس ارشد؛ مزدک راد ملکشاهی ، استادیار؛ هادی ولادی ، استادیار

n.talebzadeh90@ms.tabrizu.ac.ir – دانشگاه تبریز – تبریز – ایران – n.talebzadeh90@ms.tabrizu.ac.ir ۲- دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – ایران – m.malekshahi@razi.ac.ir ۳- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز – تبریز – ایران – veladi@tabrizu.ac.ir

چکیده: در این تحقیق، روشی ساده، کمهزینه و نوین برای ساخت ریزالکترودهایی در دو سمت کانال سیال بهمنظور کاربرد برای ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی ارائه می شود. وجود الکترود در دو سمت ریز کانال، مشخصه های یکتا برای کاربردهایی مانند مطالعات سلول های زیستی، الکتروکینتیکس، دی الکتروفورسیس و غیره به همراه دارد. پروسه ساخت شامل لیتو گرافی نوری، لایه نشانی برای ایجاد الکترودها، انطباق دقیق و پیوند دو ویفر می باشد. در مقایسه با سایر روش ها برای ساخت الکترودهایی در دو سمت، در این روش نیازی به شرایط آزمایشگاهی بسیار سخت و پیچیده، پروسه سنگین و تجهیزات گران قیمت نیست. آنالیز عددی بر روی توزیع میدان الکتریکی برای دو حالت آرایش الکترودی در دو وجه و تنها یک وجه از ریز کانال انجام گرفته است تا برتری آرایش الکترودی در دو سمت را نشان دهد. در این مقاله، تراشه ساخته شده و نتایج عملی، ارائه شده و در نهایت تأثیر عدم انطباق کامل به دلیل وجود لایه ای از 8-SU نشان داده شده است. تکنیک پیشنهادی جایگزین مناسبی در مقابل الکترودهای یک سمته می باشد. سادگی پروسه، روشی آسان برای ساخت سریع ریز الکترودهایی در دو سمت را نشان دو سمت آز ریز کانال انجام گرفته است تا برتری آرایش الکترودی در دو سمت را نشان دهد. در این مقاله، تراشه ساخته شده و نتایج عملی، ارائه شده و در نهایت تأثیر عدم انطباق کامل به دلیل وجود لایه ای از 8-SU نشان داده شده است. تکنیک پیشنهادی جایگزین مناسبی در مقابل الکترودهای یک سمته می باشد. سادگی پروسه، روشی آسان برای ساخت سریع ریز الکترودهایی در دو سمت از ریز کانال به منظور اختلاط سیالات

واژههای کلیدی: ریزسیالات، آرایش الکترودی در دو جهت، ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی، کارایی اختلاط، عدم انطباق.

A Novel Method to Construct a Double-side-electrode Electroosmotic Mixer for Biotechnological Applications

Nima Talebzadeh, MSc1; Mazdak Rad Malekshahi, Assistant Professor2; Hadi Veladi, Assistant Professor3

1-Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: n.talebzadeh90@ms.tabrizu.ac.ir
 2- Faculty of Engineering, University of Razi, Kermanshah, Iran, Email: m.malekshahi@razi.ac.ir
 3- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: veladi@tabrizu.ac.ir

Abstract: We report a simple, low-cost and novel method for constructing double-side microelectrodes in microfluidic electroosmotic mixer. Double-side electrodes have unique properties in some applications such as study of biological cells, electrokinetics, dielectrophoresis and so on. The fabrication process involves photolithography, sputtering techniques to fabricate the electrodes, precise alignment and plasma bonding. Compared to other fabrication methods for double-side electrodes, the presented one does not require rigorous experimental conditions, cumbersome processes and expensive equipment. Numerical analysis on electric field distribution for single-side and double side electrode configurations is presented to verify the unique field distribution of double-side electrodes. Fabricated device with experimental results are illustrated. Eventually, the effect of misalignment due to a layer of SU-8 is depicted. The proposed technique offers alternatives to construct double-side electrodes from single-side electrodes. The simplicity of the fabrication process provides easy ways to fabricate electrodes fast in double-side of microchannel for mixing purposes.

Keywords: Microfluidics, Double-side electrode, Electroosmotic micromixer, Mixing efficiency, Misalignment.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ تاریخ اصلاح مقاله: ۱/۱۸۸ و ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ نامانی نویسنده مسئول: ایران – تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر.

۱ – مقدمه

امروزه با پیشرفت سریع علم و تمایل رو به فزون برای رشد در زمینههای پزشکی، زیستفناوری، نانوتکنولوژی، تحقیقات دارویی و حتی نظارت و کنترل بر محیط زیست، دنیای امروزی بهطور قابل توجهی وابسته به تحلیلها، آنالیزها و سنتزهای شیمیایی شده است. بهویژه با موفقیت در پروژه ژنوم انسان، ادوات، سیستمها و تراشههای مبتنی بر ریزسیالات و ریزتراشههای آزمایشگاهی^۱، جایگاه خاصی در مطالعات، تحقیقات، صنعت و تجارت پیدا کردهاند. همچنین در سال ۲۰۰۴ بر اساس مطالعهای که در دانشگاه MIT صورت گرفته بود، تکنولوژی و علم ریزسیالات بهعنوان یکی از ۱۰ علومی معرفی شد که در آینده جهان را متحول خواهد کرد [۱].

حجم بالای تحلیل، آنالیز و پردازش موازی در یک تراشه مبتنی بر ریزسیالات باعث افزایش کارایی، سرعت پاسخدهی، بازده و نمایش اطلاعات متعدد در محدوده وسیعتری گردیده است، چرا که کامپیوترهای امروزی معمولاً تا ۲۰ پردازشگر موازی دارند در حالی که تراشههای مبتنی بر ریزسیالات تا چندین ۱۰۰ عدد ظرفیت پردازش موازی را دارا هستند. این حجم عظیم پردازش موازی در این تراشهها، در کاربردهای پزشکی بهویژه تشخیصات مبتنی بر DNA، از اهمیت ویژهای برخوردار است.

شایان ذکر است بهتازگی با ورود مواد تازهای به حیطه الکترونیک و تکنولوژی ریزساخت بهویژه پلیمرها و پلاستیکها، پیشرفت شگرفی در تکنولوژی ریزسیالات بهوجود آمده است. بهطوری که مفاهیم و تعاریف جدیدی همچون 'Lab-on-foil' وارد این زمینه شده و مطالعات فراوانی را به سمت خود جذب کرده است. در این تکنولوژی ماده اصلی بهکار بردهشده در تراشهها، پلیمرها و انواع مواد پلاستیکی می باشد که قابلیت انعطاف و خمش فراوانی دارند [۲].

برای درک عمیق تر پیشرفتهای شکل گرفته در زمینه تکنولوژی ریزسیالات و مقایسه آن با تکنولوژی مدارهای مجتمع الکترونیکی، در یکی از تحقیقات انجام گرفته در مجله Nature، قانون مور^۲ که نرخ مجتمع سازی ترانزیستور برای مدارهای نیمههادی را بیان میکند، در قیاس با نرخ مجتمع سازی ریزدریچهها در تکنولوژی ریزسیالات تا اواخر سال ۲۰۰۴ قرار گرفته است که در شکل ۱ نشان داده می شود [۳].

با توجه به شکل ۱ قانون مور با نرخ ۴ برابر برای چگالی دریچههای موجود در یک تراشه ریزسیالات صدق میکند. المان دریچه یا سوپاپ در تراشههای ریزسیالات بهصورت دوگان المان ترانزیستور در مدارهای نیمههادی عمل میکند. بدینصورت که یک دریچه بهصورت یک سوئیچ است که باعث هدایت یا قطع جریان سیال در ریزکانالها می شود و کاری مشابه ترانزیستور در مدارهای دیجیتالی انجام می دهد.

عمل مخلوط کردن نمونهها و مایعات با همدیگر، یک مرحله کاملاً اساسی و حیاتی در همه زمینههای علوم آزمایشگاهی، زیستفناوری،

نانوتکنولوژی، زیستشناسی و شیمیایی میباشد چرا که در اکثر این آزمایشها نیاز به مخلوط کردن نمونه مورد آزمایش با شناساگر (معرف) یک نیاز مبرم و حتمی میباشد. در حقیقت اختلاط سیالها، مرحله آمادهسازی نمونهها برای کارها و پردازشهای متعاقب روی آنها بوده و به همین خاطر از اجزاء بسیار مهم در تراشههای ریزسیالات به حساب میآید. شایان ذکر است اگر به ریزمخلوطگرها بهعنوان یک المان مولد گرادیان و همچنین برچسبزن (نشانه گذار) نیز نگاه کنیم، کاربرد بسیار گستردهتری در زیستشناسی و IMCS خواهد داشت [8-4].



شکل ۱: قانون مور و مقایسه آن با نرخ افزایش چگالی دریچهها در یک تراشه ریزسیالات [۳]

در سیالات وقتی وارد دنیای میکرو می شویم، اثر نیروهای چسبندگی بین مولکولی بیشتر شده و سیال خاصیت لایهای^۳ پیدا میکند، به همین دلیل پدیده اصلی انتقال و اختلاط مایع، انتشار مولکولی^۴، فرارفت⁶ و پراکندگی تیلور^{*} می باشد [۷]. با توجه به روش و نحوه اختلاط، ریزمخلوط گرها به دو گروه فعال^{*} و غیر فعال^{*} دسته بندی می شوند. در نوع غیر فعال هیچ گونه جزء متحرک یا اعمال نیرو از خارج به سیستم وجود ندارد و عمل اختلاط فقط مبتنی بر سرعت سیال، نوع، هندسه و پیکربندی ساختار (برای افزایش سطح تماس دو انرژی (مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی و ...) از بیرون برای افزایش انرژی است ساختارمان کارایی اختلاط مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن است ساختارمان

در حالت کلی ریزمخلوط گرهای غیر فعال دارای کارایی و سرعت پاسخدهی نسبتاً پایین بوده و در نتیجه نیازمند تراشهای با ابعاد بزرگ هستند. با معرفی ریزمخلوط گرهای فعال، راندمان و سرعت پاسخدهی افزایش یافته و ابعاد تراشه مورد استفاده میتواند کوچکتر شود. ولی از دیدگاهی دیگر پیچیدگی ساخت نسبتاً بالا و توان مصرفی و طراحی بهینه برای پارامترهای متفاوت، چالشهایی را برای ریزمخلوط گر فعال به همراه میآورد. از ریزمخلوط گرهای نوع فعال میتوان به ریزمخلوط گر مبتنی بر فشار هیدرولیکی یا بادی، نیروی مغناطیسی، امواج صـوتی و فراصـوتی، امـواج اپتیکـی و نیـروی مبتنـی بـر میـدان الکتریکی (الکتروکینتیکس^م) اشاره کرد [۱۹–۸].

الکترواسمتیک^۱) یا ریزذرات داخل سیالات (الکتروفورسیس^۱) تحت (الکترواسمتیک^۱) یا ریزذرات داخل سیالات (الکتروفورسیس^۱) تحت میدان الکتریکی میباشد. در پدیده الکترواسمتیک وقتی سیال درون یک کانال در حال حرکت است، در اثر حرکت و سایش سیال با دیواره کانال، پدیده دولایه الکتریکی^۱ بهوجود میآید که باعث بازچینش و تجمع یونهای غیر همنام در نزدیکی سطح تماس سیال با دیواره کانال میشود و چگالی بار غیر صفر را در سطح تماس دو فاز ماده بهوجود میآورد که با اعمال میدان الکتریکی، در اثر این پدیده سیال به حرکت در میآید [۱۹]. کارایی و بازدهی بالا، پیچیدگی کمتر، چه در مرحله ساخت و چه در مرحله استفاده، عدم وجود قسمت متحرک، در مرحله ساخت و چه در مرحله استفاده، عدم وجود قسمت متحرک، الکترواسمتیک میباشند. این نوع ریزمخلوط گرها خود میتوانند به دو گروه تقسیم شوند: آرایش آرایه الکترودی فقط در یک وجه از ریزکانال و کنار هم؛ و یا در دو وجه از ریزکانال و بهصورت روبرو.

بهدلیل سهولت ساخت برای ریزمخلوط گرهایی که آرایش الکترودی آنها فقط در یک وجه ریز کانال میباشد، تحقیق و مطالعه برای این نوع ریزمخلوط گرها بسیار گستردهتر است. در حالی که برای حالت دوم آرایش الکترودی، اکثر مطالعات انجام گرفته فقط متکی به شبیهسازیها و تحلیلهای کامپیوتری بوده و روشی برای ساخت ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی با الکترودهایی در دو سمت پیشنهاد داده نشده است. هدف اصلی در این مقاله ارائه یک روش نوین برای ساخت یک ریزمخلوط گر مبتنی بر پدیده الکترواسمتیک با جاگذاری الکترودهایی در دو سمت کانال اختلاط (کف و سقف) میباشد که هزینه کم، روش ساخت آسان، انطباق پذیری با تکنولوژی IC و مهم تر از همه، کارایی، بازدهی و سرعت پاسخدهی بسیار بالا بهدلیل نحوه توزیع میدان الکتریکی در داخیل کانال، از مزیتهای عمده ریزمخلوط گر پیشنهادی خواهد بود.

در یکی از تحقیقاتی که بهصورت تئوری و تجربی انجام گرفته، دو مسیر از الکترود به شکل سینوسی در کنار هم در کف میکروکانال ایجاد شده که با اعمال ولتاژ متناوب به آن باعث ایجاد تلاطم در سیال میشود. در این مطالعه ولتاژ اعمالی تا ۲۰ ولت قله به قله افزایش یافته و برای بازه فرکانسی ۱ الی ۵ کیلوهرتز کارایی مخلوط گر اندازه گرفته شده است. پهنا و عمق ریزکانال بهترتیب ۱۲۰ و ۴۰ میکرومتر بوده و به روش اپتیکی (فلورسنت) بازدهی ریزمخلوط گر بازخوانی شده که بیشترین کارایی در ولتاژ ۲۰ ولت قله به قله و فرکانس ۱ کیلوهرتز بوده و مقدار آن برحسب درصد، ۹۲٪ بهدست آمده است [۲۰].

بهعنوان پژوهشی دیگر، ۴ طـرح مختلـف از آرایـش الکترودهـا در یک وجه از ریزمخلوط گر، ارائه و ساخته شده است [۲۱]. زمان اختلاط کامل در طرح اصلی ۲ دقیقه و ۰/۸۶ ثانیه گزارش شده و نوع چینش و هندسه الکترودها به گونهای است که با اعمال ولتاژ ac دائماً نیرویـی در

جهت ساعت گرد و پاد ساعت گرد به سیال داخل ریز کانـال وارد شـده و باعث اختلاط آن می شود. در این مطالعه، ولتـاژ قلـهبـهقلـه ۲۰ ولـت و فرکانس ۲ کیلوهرتز به الکترودها اعمال شده است.

در تحقیق دیگری که الکترودها فقط در یک وجه (کف کانال) قرار گرفتهاند، فرکانس ac اعمالی به الکترودها در بازه ۱۰ الی ۱۰۰ کیلوهرتز و ولتاژ قلهبهقله در بازه ۱۵ الی ۲۰ ولت بوده است [۲۲]. آرایش الکترودها به این گونه میباشد که به اندازه یک سوم پهنای کف کانال الکترود با پلاریته مثبت (منفی) و به اندازه دو سوم پهنای کف میکرومتری در مقابل هم قرار دارند. (پهنای کانال در این تحقیق ۲۰۰ میکرومتر در نظر گرفته شده است) ساخت این ریزمخلوط گر با تکنولوژی Soft-Lithography روی بستری از BDMS انجام گرفته و نوه نشاندن الکترودها به روش PDMS بوده است.

در یک پژوهش تجربی که آرایش آرایه الکترودی فقط در کف کانال قرار گرفته است، هدف اصلی بررسی تأثیر تعداد جفت الکترودها در بازدهی اختلاط بوده که نتایج نیز حاکی از تأثیر قابل ملاحظه تعداد جفت الکترودها بر کارایی ریزمخلوط گر میباشد [۲۳]. در بررسی نتایج بعنوان مثال شاخص اختلاط زمانی که ۳ جفت الکترود داریم ۹۵/۱. در فرکانس اعمالی ۱۰ کیلوهرتز و ۹/۷۶٪ در فرکانس ۱ مگاهرتز بوده است.

در نهایت برای تبیین اهمیت ریزمخلوط گرهای الکترواسمتیکی مرجع [۲۴] جدولی جامع تدوین کرده است که در این جدول چندین شرکت معتبر بینالمللی در زمینه ساخت ریزتراشههای بیولوژیکی نام برده شده و نمونه مورد استفاده برای آزمایش بیولوژیکی، نحوه اعمال سیال یا نمونه به داخل تراشه، نحوه کنترل و اختلاط سیال را ارائه داده است. برای مرحله اختلاط، ریزمخلوط گر مبتنی بر پدیده الکتروکینتیکس محبوب ترین و پرکاربردترین ریزمخلوط گر بین ریزمخلوط گرهای فعال بوده و تمامی جایگاهها را به خود اختصاص داده است.

توانایی ساخت و جاگذاری الکترودها در دو سمت از کانال یک Lab-on-chip حوزههای بسیار نوین و مختلفی را در تکنولوژی ریزسیالات بههمراه آورده است و مزیتهایی دارد که در آرایش الکترودی در یک سمت قابل دسترسی نیست. گرادیان زیاد میدان نیروی حاصل از پدیده الکترواسمتیک یا الکتروکینتیک شده که سرعت پاسخدهی، کارایی و مجتمعپذیری بالا را بههمراه خواهد داشت. از ریز کانال، امکان برآورد بهتر و شناسایی دقیق تر حجم سیال، وجود ریز کانال، امکان برآورد بهتر و شناسایی دقیق تر هماه از یک وجه اندازه گیری امپدانس محلی و یا ظرفیت خازنی میباشد [۵۵]. بهعنوان مثال، با تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در زمینه ساخت الکتروهایی در بیش از یک سمت ریزکانال، کارایی و مجتمع پذیری بسیار زیاد در (۳) ELISA^۳ و تکنولوژی EWOD^{۱۴} گزارش شده است [۲۷ و ۲۶].

> در این مقاله روشی تازه، کمهزینه، ساده و سازگار با سلولهای زیستی برای ساخت یک ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی با الکترودهایی در دو سمت کانال ارائه میشود. برای تبیین اهمیت این نوع ریزمخلوط گر، ابتدا مقایسهای بین ریزمخلوط گر مبتنی بر پدیده الکترواسمتیک با الکترودهایی در دو سمت کانال (کف و سقف) و یک سمت کانال (کف) با استفاده از نرمافزار مالتی فیزیک COMSOL سمت کانال (کف) با استفاده از نرمافزار مالتی فیزیک Soft-lithography برای ساخت ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی با الکترودهایی در دو وجه آن ارائه میشود که مقرونب مصرفه بودن، سادگی ساخت، سرعت پاسخدهی، کارایی بالای ریزمخلوط گر و ابعاد کوچک تراشه، از مزیتها و نتایج مهم پروسه پیشنهادی میباشد.

> ساختار مقاله به این صورت است که در فصل ۲ تئوری و روابط حاکم بر این نوع ریزمخلوط گرها، در بخش ۳ ساختار و پیکربندی ریزمخلوط گر پیشنهادی، در بخش ۴ پروسه پیشنهادی برای ساخت ریزمخلوط گر با الکترودهایی در دو سمت و تأثیر عدم همترازی^{۱۵} آرایش الکترودی در مرحله ساخت و در نهایت در بخش ۵ نتیجه گیری، ارائه و تبیین خواهد شد.

۲- تئوری و روابط حاکم

در این فصل ابتدا به تبیین پایههای نظری و تئوری دینامیک سیالات از دو دیدگاه میکرو و ماکرو پرداخته و سپس در مورد ماهیت پدیده الکترواسمتیک و ریزمخلوط گرهای مبتنی بر آن صحبت کرده، روابط حاکم، مفاهیم و پایههای نظری این نوع ریزمخلوط گر را بیان میکنیم.

سیالات بهوسیله گروهی از معادلات با مشتقات جزئی غیر خطی به نام معادلات نویر -استوکس^{۱۰} شناخته می شوند. این معادلـه در فـرم برداری به صورت زیر می باشد [۲۸]:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla .(\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{1}$$

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho(\mathbf{u}.\nabla)\mathbf{u} + \nabla \mathbf{p} - \mu \nabla^2 u$$

-(\lambda + \mu)\nabla (\nabla.\mu) = f (\lambda)

که q بیانگر چگالی سیال، u بردار سرعت سیال، p فشار موجود در سیال، µ گرانروی (ویسکوزیتی) سیال دینامیک، λ یک ضریب ویسکوزیتی ثانی و f بردار نیروی جرم سیال میباشد. این رابطه عموماً برای یک سیال قابل تراکم چسبناک^۷ استفاده میشود که با حرکت به سمت ابعاد کوچک و ریزسیالات، میتوان مایع را غیر قابل تراکم در نظر گرفت. چرا که در این ابعاد تغییرات چگالی در ریزسیالات در اثر تغییرات فشار نامحسوس و قابل صرفنظر میباشد که در این صورت معادلات حاکم، بهصورت معادلات غیر فشرده نویر استوکس به صورت زیر ساده میشوند:

$$\nabla \mathbf{u} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 u \tag{(f)}$$

در این رابطه ۲/۵=۷ میباشد که ویسکوزیتی حرکتی^{۱۰} اطلاق میشود. برای سهولت درک رفتار و روابط حاکم در ریزسیالات برای مهندسین الکترونیک، مرجع [۲۹] جدولی از دوگان نمادهای همارز الکترونیکی و سیالات تهیه کرده است. وقتی با ریزسیالات سروکار داریم، قانون پایستگی جرم (حجم) همارز با قانون پایستگی بار در علم الکترونیک میشود. قانون اهم نیز بهصورت دوگان در سیالات برقرار است.

الکترواسمتیک یکی از پدیدههای بسیار مهم و همچنین بسیار مؤثر در ایجاد نیرو و فشار به سیالات بهویژه در ابعاد ریز می،باشد. مرجع این نیرو، متکی بر لایهای از بارها است که معمولاً در حد چندین نانومتر است. بههمین دلیل ابعاد و کانالهای کوچک و ریزسیالات برای استفاده از چنین نیرویی بسیار مناسبتر، مؤثرتر و کارآمدتر هستند.

فرض کنیم یک کانال با محلول الکترولیتی پر شده باشد. در محل تماس دیواره کانال با سطح سیال- در سطح تماس این دو فاز- یک نیمواکنش شیمیایی محلی یا جاذبه کولونی اتفاق افتاده و باعث به وجود آمدن بار الکتریکی در دیواره کانال شده و در نتیجه موجب غیر صفر شدن پتانسیل الکتریکی در این ناحیه می شود. به این سطح، دولایه الکتریکی اطلاق میشود. شکل ۲ توزیع پتانسیل و بار را در دولایه الکتریکی نمایش میدهد. دقیقاً در کنار این سطح تماس، لایهای مقاوم و بی حرکت و ثابت از یون ها که چسبیدهاند به سطح کانال شکل می گیرد که با نام لایه فشرده یا لایه استرن ۱۰ شناخته می شود. این لایه فقط از یون های با بار مثبت (منفی) تشکیل یافته است. در این لایه یون ها به دلیل نیروی ربایش متقابل بسیار زیاد با بارهای غیر همنامشان، در دیواره کانال کاملاً ثابت و بی حرکت هستند. در پس این لایه پایدار، لایهای قابل تحرک از یون ها وجود دارد که لایه گوی-چاپمن ۲۰ یا لایه دیفیوز نامیده میشود. در واقع مجموع لایه استرن و لایه دیفیوز تشکیل دولایه الکتریکی را میدهند. در بیرون از دولایه الکتریکی، سیال از نظر الکتریکی خنثی میباشد. دو لایه استرن و دیفیوز بهوسیله یک خط برشی از هم جدا می شوند که پتانسیل مربوط به این خط برشی، پتانسیل زیتا (۲) اطلاق می شود [۳۰].



شکل ۲: توزیع پتانسیل و بار در دولایه الکتریکی در محل سطح تماس سیال با دیواره کانال در اثر پدیده الکترواسمتیک [۳۰]



سرعت جریان الکترواسمتیکی بهوسیله حل معادله نویر⊣ستوکس به یک نیروی بدنه معلوم بهوسیله *P*eE بهدست میآید. *pe چگ*الی بار خالص و E میدان الکتریکی اعمالی میباشد. چگالی بار خالص از توزیع یونها در دولایه الکتریکی از معادله پواسون^{۱۲} بهقرار زیر بهدست میآید: (در واقع در این معادلات، مقدار *p*e را داشته و ψ را بهدست میآوریم)

$$\varepsilon \nabla^2 \psi = \rho_{\varepsilon} \tag{(b)}$$

که در این رابطه ٤ ثابت دیالکتریک و ۷ توزیع پتانسیل دو لایه الکتریکی میباشد. در ریزسیالات زمانی که دیوارههای کانال به حد کافی از همدیگر دور هستند و بار خالص در مرکز کانال تقریباً خنثی بوده، توزیع بار خالص در بیرون از سطح برشی در دولایه الکتریکی بهوسیله توزیع بولتزمن به شکل زیر توصیف می گردد:

$$\rho_{e} = -2zec_{0} \sinh(\frac{ze\psi}{LT}) \tag{(4)}$$

که برای شرایط متقارن الکترولیتی، Z بیانگر والانس، co غلظت الکترولیت بدنه، e بار یک الکترون، Kb ثابت بولتزمن و T دمای سیال میباشد. بنابراین با جاگذاری دو رابطه (۵) و (۶) در هم، معادله دیفرانسیلی حاکم برای توزیع پتانسیل به معادله (۷) تبدیل خواهد شد:

$$\nabla^2 \psi = \frac{-2zec_0}{\varepsilon} \sinh(\frac{ze\psi}{k_b T}) \tag{V}$$

شایان ذکر است زمانی که پتانسیل دیوارهها در حدود ۲۶ میلیولت باشد، رابطه (۷) با استفاده از تقریب دبیی-هوکل^{۲۲} به یک رابطه خطی تبدیل میشود [۳۱].

۳- معرفی ساختار ریزمخلوط گر پیشنهادی

در این بخش به تفضیل ریزمخلوط گر پیشنهادی با جفت الکترودهـایی در دو سمت، ساختار، پیکربندی و نوع سیال به کاربرده شده در این ریزمخلوط گر معرفی می شود. پیکربندی و ابعاد ریزمخلوط گر پیشنهادی بهصورت سهبعدی، سطح مقطعی دوبعدی و دید از بالا به ترتیب در شکل ۳ نمایش داده شده است. پهنای ورودی هر یک از سیالات ۵۰ میکرومتر بوده که به یک کانال به ضخامت ۱۰۰ میکرومتر وارد می شوند. دو جفت الکترود در دو وجه سقف و کف کانال به منظور اعمال میدان الکتریکی برای اختلاط سیال در نظر گرفته شده است. یهنای هر کدام از الکترودها ۵۰ میکرومتر بوده و با فاصله ثابت ۵۰ میکرومتر در کنار هم چیده شدهاند. الکترودهای قرمز رنگ پلاریته مثبت ولتاژ و الکترودهای آبی رنگ پلاریته منفی ولتاژ را به خود اختصاص دادهاند. زیرلایه بالایی و پایینی از جنس پایرکس بوده و ارتفاع آنها ۳ میلیمتر میباشد. علائم ترازها در یکی از زیرلایهها به شکل "بهعلاوه" با پهنای شاخههای ۱۰۰ میکرومتر و طول ۱/۵ میلیمتر و در زیرلایه دیگر، علامت مکمل آن با پهنای ۱/۵ میلـیمتـر برای انطباق دو ویفر طراحی شدهاند.



شکل ۳: پیکربندی و ابعاد ریزمخلوط گر پیشنهادی بهصورت الف) سه بعدی، ب) سطح مقطعی دوبعدی و ج) دید از بالا

برای یک سیال دو نوع مشخصه فیزیکی می وان در نظر گرفت: ترموفیزیکی و الکتریکی. این مشخصات و همچنین پارامترهای پیشفرض و توضیح آنها برای سیال به کار بردهشده در شبیه سازیها و نتایج آزمایشگاهی به صورت جدول ۱ نمایش داده شده است [۳۲].

دول ۱: مشخصات سیال و پارامترهای پیشفرض [۳۲]

پارامتر	مقدار	توضيحات
ρ	1000 kg/m ³	چگالی سیال
η	10 ⁻³ Pa·s	ويسكوزيتي ديناميك سيال
U_0	0.1 mm/s	سرعت ميانگين ورودي سيال
εr	80.2	گذردهی الکتریکی نسبی سیال
ζ	-0.1 V	پتانسیل زیتا در مرز دیوار و سیال
σ	0.11845 S/m	هدایت محلول یونی
D	10 ⁻¹¹ m ² /s	ضريب انتشار
C_0	1 mol/m ³	غلظت اوليه

۴- نتايج

این بخش خود شامل دو فصل میباشد. ابتدا به صورت خلاصه برای تبیین اهمیت استفاده از آرایش الکترودی در دو سمت کانال و مشهودتر شدن کارایی، بازده و سرعت پاسخدهی زیاد برای ریز مخلوط گر الکترواسمتیکی پیشنهادی، مقایسهای با حالتی که آرایش

الکترودها تنها در یک سمت است، انجام می گیرد. سپس شبیه سازی ریز مخلوط گر برای دو حالت پاسخ زمانی و پاسخ حالت دائم انجام یافته، پروسه ساخت گامبه گام و با جزئیات کامل به همراه تراشه ساخته شده و سیستم راهاندازی مورد استفاده، نمایش داده می شود. در نهایت نیز اثر عدم همترازی در جفت الکترودهای روبرو بررسی می شود.

۴-۱- مقایسه دو آرایش الکترودی و ارائه پروسه ساخت

قبل از ارائه پروسه ساخت، برای بررسی، تحلیل و نمایش هرچه بیشتر مزیت ریزمخلوط گر پیشنهادی، مقایسه ای از توزیع میدان الکتریکی تولیدی در داخل ریز کانال برای این ریزمخلوط گر با حالتی که آرایش الکترودی فقط در یک سطح قرار دارد، انجام می گیرد. از آن جایی که بسیاری از ادوات ریزسیالات بر مبنای آرایش الکترودی سطحی تنها در یک وجه (غالباً کف کانال) می باشند، غالب نیروی PEP^{۱۲}، تنها در اطراف الکترودها حاصل می شود و با حرکت از سطح الکترودها تا سقف نیروی بسیار زیادی برای تحت تأثیر قرار دادن سیال یا ریزذرات در نیروی بسیار زیادی برای تحت تأثیر قرار دادن سیال یا ریزذرات در ریزالکترودهایی در سقف و کف کانال این کاستی تا حد بسیار زیادی جبران شده و نیروی PEF بسیار زیادی در کل سطح مقطع کانال ایجاد می شود که برای ادوات ریزسیالات باعث پاسخدهی سریعتر،

همان طور کـه در بخـش ۲ مقالـه اشـاره شـد، بـا اعمـال ميـدان الکتريکی به سيال، نيروی وارد بر آن $ho_e E$ میباشد، بهعبارتی: $F_{EOF}=
ho_e E$ (۸)

با استفاده از روابط (۸-۵) رابطه (۹) بهدست خواهـد آمـد کـه بـا جـزئیات کامـل تـر نـیروی بـدنه اعمـالی الکترواسـمتیکی را نشـان می دهد [۳۳]:

$$F_{EOF} = \frac{-2zec_{o}}{\varepsilon} \sinh(\frac{ze\psi}{k_{o}T}) \nabla \psi$$
(9)

همان طور که در رابطه (۸) مشاهده می شود، نیروی اعمالی به سیال رابطه مستقیم با میدان اعمالی به آن دارد. هنگامی که الکترودها فقط در یک سمت جاگذاری شدهاند، خطوطی از میدان که نیروی اصلی و بزرگی تولید می کنند، در سطح مقطع کانال توزیع یکنواخت نداشته و فقط در سطح نزدیک به الکترودها تأثیر بسزایی می توانند روی سیال داشته باشند. چرا که این خطوط با افزایش فاصله از سطح الکترودها تا سقف کانال به شدت ضعیف تر می شوند، در حالی که در آرایش دو وجهی الکترودها، در دو سطح الکترود که سقف و کف کانال را شامل می شود، میدان بیش ترین مقدار خود را داشته و در قسمت میانی کانال به کمینه مقدار خود می رسد که در این آرایش الکترودی، سیال یک نیروی بسیار بزر گ تری را در یک سطح مقطع مشخص تجربه می کند.

شکل ۴ توزیع میدان الکتریکی نرمالیزه در داخل یک ریزکانال از کف تا سقف آن با جفت الکترودهای جاگذاری شده فقط در کف (الف) و هر دو سمت کف و سقف (ب) را نشان میدهد. در این شبیه سازی دامنه ولتاژ اعمالی به الکترودها در هر دو حالت یکسان بوده و گستره آن از مقدار بیشینه قرمز رنگ تا مقدار کمینه آبی رنگ می باشد. همان طور که مشاهده می شود در حالت کلی توزیع میدان الکتریکی نرمالیزه شده در حالت ب سیار بزرگ تر بوده و نیروی بیش تری در یک سطح مقطع مشخص از کانال، به سیال وارد می شود.



شکل ۴: میدان الکتریکی نرمالیزهشده در داخل یک ریزکانال از کف تا سقف برای حالتی که: الف) فقط در یک سمت جفت الکترود داریم و ب) در هر دو سمت جفت الکترود جاگذاری شده است.

حال به بررسی کارایی و سرعت پاسخدهی ریزمخلوط گر پیشنهادی می پردازیم. در این مقاله برای انجام شبیه سازی ها و تحلیل نتایج از نرمافزار مالتی فیزیک COMSOL استفاده شده است که قابلیت فراوانی برای کوپل انواع محیط ها را داراست. کارایی اختلاط در سطح مقطع خروجی ریزکانال، از رابطه زیر اندازه گرفته می شود که بازدهی اختلاط را به صورت درصد بیان می کند [۳۳]:

$$\left[1 - \frac{\int_{\text{lower surface}}^{\text{upper surface}} |c - c_{\infty}| \, dy}{\int_{\text{lower surface}}^{\text{upper surface}} |c_{0} - c_{\infty}| \, dy}\right] \times 100 \tag{1}$$

که Co مقدار غلظت اولیه زمانی که هیچ اختلاطی اتفاق نیفتاده (که در این مقاله عدد صفر یا یک میباشد)، C مقدار غلظت نهایی بعد از اتمام شبیهسازی و ۲۰ مقدار غلظت در حالت اختلاط کامل را نشان میدهد (که در این مقاله عدد ۲/۵ میباشد). سیال شماره یک با رنگ قرمز و سیال دوم با رنگ آبی مشخص شده است. ولتاژ اعمالی به الکترودها، یک سیگنال سینوسی با دامنه ۲ ولت و فرکانس ۲۰ هرتز میباشد. شکل ۵ شماتیک شبیهسازیشده از توزیع غلظت و خطوط میدان سرعت در حالت دائمی در درون کانال را نشان میدهد. (غلظت دو سیال با توجه به نوع رنگشان از یکدیگر تمییز داده شدهاند)



شکل ۵: شماتیک شبیهسازیشده از توزیع غلظت بههمراه میدان سرعت برای جریان سیال

همان طور که مشاهده می گردد جریانهای گردابی در اثر اعمال ولتاژ متناوب بر سیال ایجاد شده که باعث آشفتن دو سیال و در نتیجه اختلاط آن دو می شود. پاسخ زمانی ریز مخلوط گر پیشنهادی در بازه صفر تا بیست ثانیه در شکل ۶ نمایش داده شده است. همان طور که می بینیم با گذشت زمان میزان اختلاط دو سیال افزایش یافته و به حالت نهایی خود نزدیک می شود. در شکل ۷ نیز پروفایل غلظت در سطح مقطع خروجی برای حالت دائمی رسم شده است که میزان کارایی این ریز مخلوط گر را نشان می دهد. با استفاده از رابطه شماره (۸)، بازدهی برای این ریز مخلوط گر در حالت دائمی ۲۵/۶٪ به دست آمد.



در این مقاله روش نوینی برای ساخت یک ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی با آرایش الکترودی در هر دو سمت ریزکانال اختلاط

تبیین شده و نتایج عملی گزارش میشود. گامهای این پروسـه سـاخت بهصورت شماتیکی سهبعدی در شکل ۸ نمایش داده شده است.



شکل ۷: پروفایل غلظت در سطح مقطع خروجی برای ریزمخلوط گر پیشنهادی در حالت دائم به همراه میزان کارایی

الف) ابتدا یک seed layer از جنس مس روی ویفر پایرکس به روش sputtering یا evaporation نشانده شده است. برای این کار ابتدا کروم با ضخامت ۴۰ نانومتر بهعنوان لایه واسطه برای ایجاد چسبندگی بین سطح مس و پایرکس نشانده و سپس مس به ضخامت ۱۰۰ نانومتر مینشانیم. حال فتورزیست روی ویفر نشانده و با ماسک مناسب، تابش UV و developer مخصوص، آن را pattern کرده و سپس ویفر را داخل محلول حل کننده فلز قرار داده تا فقط قسمتهای مطلوب از layer seed باقی بماند که همان طرح الکترودها و علائم تراز خواهد بود. حال ویفر را داخل استون قرار داده تا فتورزیست از سطح آن جدا شود. طرح نهایی در این مرحله بهصورت شکل ۸-الف خواهد بود.

ب) حال یک لایه بسیار نازک PDMS روی کل ویفر قرار داده می شود تا بهعنوان لایه محافظ برای جلوگیری از تماس مستقیم الکترودها و سیال عمل کند. همان طور که می دانیم فلزات موادی زیست – ساز گار نیستند و در تماس با سلول های زیستی می توانند موجب تغییر ماهیت آنها شود. به همین دلیل معمولاً در کاربردهای زیست – فناوری یک لایه عایق برای جلوگیری از تماس مستقیم الکترودها و ذرات بایولوژیکی قرار می دهند [۳۴]. بدین منظور ابتدا PDMS را روی ویفر با سرعت مطلوب spin کرده تا به ضخامت ۵ میکرومتر از PDMS برسیم. سپس ویفر را به مدت ۲۰ دقیقه داخل oven گذاشته تا cure شود. طرح نهایی در این مرحله به مورت شکل ۸(ب) خواهد بود.

جود: طرح که یی غر این مر عد بخورت سنی ۱٫۹٫٫ و سن بود. ج) همان طور که می دانیم SU-8 ماده ای پلیمری است که زیست-سازگار بوده و برای ساخت ریز کانال ها با ضخامت های بالا در تکنولوژی ریزسیالات بسیار پرکاربرد می باشد. به همین دلیل در این تحقیق از این ماده برای ساخت کانال اختلاط استفاده می کنیم. ابتدا روی ویفر SU-8 ریخته و با توجه به ضخامت مطلوب ارتفاع کانال اختلاط (که در

این مقاله ۱۰۰ میکرومتر در نظر گرفته شده است) با دور مناسب spin میکنیم و سپس با ماسک مناسب، تابش UV و developer مخصوص، طرح کانال اختلاط با ضخامت ۱۰۰ میکرومتر روی SU-8 ایجاد میکنیم. طرح نهایی در این مرحله بهصورت شکل ۸-ج خواهد بود. د) اکنون یک ویفر جدید انتخاب کرده و مراحل الف و ب را برای این

ویفر با علائم تراز مکمل انجاب کرده و مراحل الله و ب را برای این ویفر با علائم تراز مکمل انجام می دهیم. اکنون با استفاده از تکنیکهای مختلفی از جمله استفاده از لیزر، مجاری ورودی و خروجی را روی هر دو ویفر ایجاد می کنیم. حال به مرحله bond کردن دو ویفر رسیدهایم. ابتدا برای اینکه سطح دو ویفر به خوبی به هم بچسبند، هر دو ویفر را تحت تابش پلاسمای اکسیژن قرار داده و سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری، علائم تراز بین دو ویفر را به دقت روی هم تراز کرده و دو ویفر را به هم می چسبانیم. شماتیک نهایی ریزمخلوط به صورت شکل ۳-الف خواهد بود.



شکل ۸: مراحل ساخت ریزمخلوط گر پیشنهادی، الف) نشاندن و pattern کردن seed layer روی یک ویفر پایرکس، ب) اعمال لایه محافظ روی الکترودها، ج) ساخت ریزکانال اختلاط با 8-SU با ضخامت ۱۰۰ میکرومتر.

rojection در این تحقیق برای انجام عمل فتولیتو گرافی، از روش projection در این اندام النقاده شده است. مزیت این روش کوچ کسازی طرح

ماسک بر روی ویفر به اندازه دلخواه میباشـد. سیسـتم راهانـدازیشـده برای استفاده از این روش در شکل ۹ با جزئیات کامل نمایش داده شده است.



شکل ۹: سیستم راهاندازی شده برای عمل لیتوگرافی از نوع projection photolithography

یکی از مراحل بسیار مهم و حساس در پروسه پیشنهادی، انطباق دقیق دو ویفر بالایی و پایینی میباشد که بهوسیله علائم تراز روی هر ویفر و با استفاده از میکروسکوپ نوری با وضوح و بزرگنمایی بسیار بالا انجام میپذیرد. شکل ۱۰ تصویر گرفته شده از میکروسکوپ را نشان میدهد که علائم تراز در روی هر دو ویفر با دقت بسیار زیادی روی هم منطبق شدهاند.



شکل ۱۰: تصویر گرفتهشده از علائم تراز دو ویفر با استفاده از میکروسکوپ نوری که بر هم منطبق شدهاند

در نهایت نیز تراشه ساختهشده به همراه سرنگهای تزریق سیال، تجهیزات مورد استفاده برای اعمال میدان الکتریکی، ارزیابی

ریزمخلوط گر و تصویربرداری از نتایج در شکل ۱۱–الف به همراه نمای نزدیک تر از خود تراشه نمایش داده شده است. شکل ۱۱–ب نیز تصویر دید از بالا را برای قسمت انتهایی کانال اختلاط نشان می دهد که بیانگر توزیع رنگ در این ناحیه بوده و کارایی اختلاط را نشان می دهد. در تصویر سمت چپ میدان الکتریکی بر سیال اعمال نشده و دو سیال بدون اختلاط در روی هم در حال حرکت می باشند که سیال سفید رنگ در کف کانال و زیر سیال سیاه رنگ قرار دارد که به دلیل تصویربرداری از سطح بالایی ریزمخلوط گر، در تصویر فقط رنگ سیاه (سیال شماره یک) مشاهده می شود. با اعمال میدان الکتریکی، دو سیال با یکدیگر مخلوط می شوند که نتیجه آن تصویر سمت راست گواهد بود. (در عمل، رنگ یکی از سیالات سفید و دیگری سیاه در نظر گرفته شده است.)



شکل ۱۱: الف) تراشه ساختهشده به همراه تمامی تجهیزات مرتبط و نمایی نزدیکتر از تراشه ، ب) خروجی ریزمخلوط گر قبل و بعد از اعمال میدان الکتریکی

۲-۴- تأثير عدم انطباق علائم تراز

همان طور که در مرحله قبل توضیح داده شد، انطباق کامل دو ویفر در مرحله نهایی با استفاده از علائم تراز، مهم ترین قسمت برای ساخت ریزمخلوط گر پیشنهادی است. بایستی متذکر شد کے بےخاطر وجود یک لایه ۱۰۰ میکرومتری بین علائم تراز دو ویفر بـالایی و یـایینی بـه احتمال زیاد دو ویفر با دقت بالا و بهدرستی روی هم قرار نگیرند که با توجه بهدقت میکروسکوب، مسئلهای گریزناپذیر میباشد و باعث یک عدم تطابق (Misalignment) خواهد شد. این عدم تطابق بین دو ویفر در مرحله bonding در دو جهت x و y میتوانـد بـهوجـود بیایـد. عـدم تطبيق در جهت y مشكل ساز نخواهد بود. زيرا جفت الكترودها همچنان روبروی هم و کاملاً مقابل هم قرار داشته و میدان الکتریکی بین این جفت الکترودهای روبرو، همچنان عمود بر حرکت سیال خواهد بود. ولی اگر عدم تطبیق در جهت x باشد، دیگر الکترودها کاملاً مقابل هم قرار نگرفته و ميدان الكتريكي بين الكترودهاي مقابل هم، عمود بر جهت حركت سيال نخواهد بود و باعث تضعيف نيروى اعمالي بــه سـيال خواهـد شـد. در ايـن قسـمت ميـزان تضـعيف و كـارايي ریزمخلوط گر در اثر عدم تطبیق دو ویفر، شبیه سازی شده و بحث می شود. در شکل ۱۲ جهت و نحوه ایجاد عدم تطابق در ساخت این نوع ریزمخلوط گر نشان داده شده است.



شکل ۱۲: نمای شیفت الکترودها در جهت x بهخاطر عدم تطابق در مرحله ساخت

برای درک شهودی این مسئله، در شکل ۱۳ توزیع ولتاژ درون کانال بهصورت رنگی و جهت گیری میدان الکتریکی در قسمت میانی کانال بهوسیله بردار برای ۸۰ میکرومتر عدم انطباق نشان داده شده است. همان طور که می بینیم برای این مقدار از عدم انطباق میدان الکتریکی ایجادشده بین دو الکترود روبرو، دیگر به صورت عمود بر حرکت سیال و کوتاه ترین مسیر نبوده و به صورت مایل می باشد که تضعیف نیروی اعمالی به سیال را منجر خواهد شد.



شکل ۱۳: توزیع ولتاژ درون کانال بهصورت توزیع رنگ و جهت میدان الکتریکی در قسمت میانی کانال بهوسیله بردار برای ۸۰ میکرومتر عدم انطباق

شماتیک شبیه سازی شده از توزیع غلظت برای این حالت برای شیفت الکترودهای مقابل هم از صفر تا صد میکرومتر با گامهای افزایشی بیست میکرومتر در شکل ۱۴ نمایش داده شده است. شکل ۱۵ نیز پاسخ زمانی برای بازه زمانی صفر تا بیست ثانیه برای شش حالت شیفت الکترودی را نشان میدهد. پاسخ حالت دائمی ریزمخلوط گر پیشنهادی برای شیفت الکترودها تا صد میکرومتر در شکل ۱۶ نشان داده شده است (استخراج این نتایج با استفاده از فرمول (۸) انجام پذیرفته است). همان طور که انتظار داشتیم با افزایش شیفت الکترودها، میدان الکتریکی بین دو الکترود روبرو از حالت عمود بر مسیر حرکت سیال در آمده و باعث کاهش نیروی مؤثر آن بر سیال و در نتیجه کاهش میزان اختلاط می شود.



شکل ۱۴: توزیع غلظت برای شیفت الکترودهای مقابل هم از ۰ تا ۱۰۰ میکرومتر با گامهای افزایشی ۲۰ میکرومتر.



شکل ۱۵: پاسخ زمانی ریزمخلوط گر برای شیفت الکترودها تا ۱۰۰ میکرومتر با گامهای ۲۰ میکرومتری.



ريزمخلوطگر پيشنهادى

همانطور که از شکل ۱۶ مشهود است، مقـادیر کـم بـرای عـدم تطابق دو ویفر (تا ۲۰ میکرومتر)، تأثیر کمی بر کـارایی ریزمخلـوط*گـر* خواهد داشت.

۵- نتیجهگیری

در این مقاله روشی نوین، ساده، مقرونبهصرفه با قابلیت مجتمع پذیری زیاد برای یک ریزمخلوط گر مبتنے بر یدیدہ الکترواسمتیک با الکترودهایی در دو سمت کانال اختلاط ارائه شد. وجود ریزالکترود در دو سمت مقابل از یک ریزکانال، مزیت و کاربردهای منحصر به فردی را برای تراشه به همراه می آورد. پروسه پیشنهادی شامل: تکنیک نشاندن seed layer، ليتوكرافي نوري، نشاندن لايه محافظ روى الكترودها و انطباق دقیق دو ویفر می باشد که با جزئیات کامل توضیح داده شد. شبیهسازی و آنالیز عددی از ریزمخلوط گر پیشنهادی برای حالت دائمی و تحلیل زمانی به همراه مقایسهای از توزیع ولتاژ درون کانال برای آرایش الکترودی در دو حالت انجام گرفت. سپس تراشه ساخته شده و نتایج عملی از اختلاط سیال ارائه شد. به دلیل وجود یک لایه ضخيم، عدم انطباق كامل بين دو ويفر در پروسه ساخت اتفاق مىافتـد که با جزئیات کامل برای حالت دائمی و آنالیز زمانی شبیهسازی شده و مورد بحث كامل قرار گرفت. ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی پیشنهادی می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای آرایش الکترودی یک سطحی باشد. مهمتر آنکه، سادگی ساخت و مجتمع یذیری بالا برای این ریزمخلوط گر، صرفهجویی زمانی و اقتصادی بالایی را به همراه میآورد.

در نهایت، تحقیق انجامشده در پارامترهای مختلف با ۳ مرجع دیگر مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج آن در جدول (۲) گزارش شده است.

جدول ۲: مقایسه پارامترهای ریزمخلوط گر پیشنهادی با ۳ مرجع دیگر

شماره مرجع	نوع آرایش الکترودی	کارایی اختلاط (./)	زمان اختلاط (ثانيه)	طول کانال اختلاط (میلیمتر)	دامنه ولتاژ اعمالی
[71]	یک وجه	٩٠	۲۷۰	٩	۲۰ ولت
[٢.]	یک وجه	٩٢	٠/٢۵	٢	۲۰ ولت
[٣٣]	دو وجه	۹۵	۱۰۰	۰/۴۵	بياننشده
این مقاله	دو وجه	۷۵/۶	۲.	١	۴ ولت

- مراجع [1] *10 Emerging Technologies that Will Change Your World,* MIT Technology Review, p. 32, February 2004.
- [2] M. Focke, *et al.*, "Lab-on-a-Foil: microfluidics on thin and flexible films," *Lab on a Chip*, pp. 1365–1386, March 2010.
- [3] J.W. Hong, and S.R. Quake, "Integrated nanoliter systems," *Nature Biotechnology*, vol. 21, no. 10, pp. 1179-1183, October 2003.
- [4] S.J. Wang, W. Saadi, F. Lin, C.M.C. Nguyen, and N.L. Jeon, "Differential effects of EGF gradient profiles on MDA-MB-231 breast cancer cell chemotaxis," *Experimental Cell Research*, pp. 180–189, August 2004.
- [5] B.G. Chung, "Human neural stem cell growth and differentiation in a gradient-generating microfluidic device," *Lab on a Chip*, pp. 401–406, March 2005.
- [6] G.S. Jeong, S. Chung, C.B. Kim, and S.H. Lee, "Applications of micromixing technology," *Analyst*, pp. 460–473, January 2010.
- [7] N.T. Nguyen, "Micromixers Fundamentals, Design and Fabrication," *Elsevier, Ch. 1*, pp. 1-8, 2012.
- [8] S.Y. Yang, and G.B. Lee, "A new vortex-type micromixer," 12th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, San Diego, California, USA, pp. 68-70, 2008.
- [9] H.H. Bau, J. Zhong, and M. Yi, "A minute magneto hydro dynamic (MHD) mixer," *Sensors and Actuators B*, vol. 79, no. 2-3, pp. 205-213, October 2001.
- [10] Y. Wang, J. Zhe, B.T.F. Chung, and P. Dutta, "A rapid magnetic particle driven micromixer," *Microfluid Nanofluid*, pp. 375–389, June 2007.
- [11] A.K. Agarwal, S.S. Sridharamurthy, D.J. Beebe, and H. Jiang, "Programmable autonomous micromixers and micropumps," *Journal of Microelectromechanical Systems*, vol. 14, no. 6, pp. 1409-1421, December 2005.
- [12] L.H. Lu, K. S. Ryu, and C. Liu, "A magnetic microstirrer and array for microfluidic mixing," *Journal of Microelectromechanical Systems*, vol. 11, no. 5, pp. 462-469, October 2002.
- [13] Z. Yang, et al., "Ultrasonic micromixer for microfluidic systems," Sensores and Actuators A, pp. 266-272, April 2001.
- [14] T. Ikegami, R. Ozawa, M.P. Stocker, J.T. Fourkas, and S. Maruo, "Active micromixer using a metallized microturbine driven by an ultra-low power laser," 16th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, Okinawa, Japan, pp. 1264-1266, 2012.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Misalignment

Stern layer

Zeta Potential

Poisson equation

Dielectrophoresis

Debye-Hückel

Navier-Stokes equations

Kinematic viscosity

Gouy chapman layer

Viscous compressible fluid

- [25] L. Ming, et al., "Improved concentration and separation of particles in a 3D dielectrophoretic chip integrating focusing, aligning and trapping," *Microfluidics and Nanofluidics*, vol. 14 no. 3-4, pp. 527-539, 2013.
- [26] N. Sonthaya, et al., "Synergistic effects of micro/nano modifications on electrodes for microfluidic electrochemical ELISA," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 156, no. 2, pp. 637-644, 2011.
- [27] S. Morishita, M. Kubota, and Y. Mita. "Integration of EWOD pumping device in deep microfluidic channels using a three-dimensional shadowmask." *IEEE 25th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)*, 2012.
- [28] J.A. Pelesko, and D.H. Bernstein, *Modeling MEMS and NEMS, A CRC Press, Ch. 2*, pp. 40-47, 2003.
- [29] D.E. Angelescu, "Highly Integrated Microfluidics Design," Norwood, Massachusetts: Artech House, Ch. 3, pp. 166-170, 2011.
- [30] C. Ren, EDL Potential, Springer, Ch. E, pp. 436-495, 2008.
- [31] S. Prakash, M. Pinti, and B. Bhushan, "Theory, fabrication and applications of microfluidic and nanofluidic biosensors," *Mathematical, Physical & Engineering Sciences*, pp. 2269-2303, April 2012.
- [32] A.Z. Kouzani, K. Khoshmanesh, S. Nahavandi, and J.R. Kanwar, "A microfluidic electroosmotic mixer and the effect of potential and frequency on its mixing efficiency," *IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics*, San Antonio, TX, USA, pp. 4618-4622, 2009.
- [33] C.K. Chen, and C.C. Cho, "Electrokinetically driven flow mixing utilizing chaotic electric fields," *Microfluid Nanofluid*, vol. 5, pp. 785–793, April 2008.
- [34] C. Michele, et al., "A soft-lithographed chaotic electrokinetic micromixer for efficient chemical reactions in lab-on-chips," Journal of Micro-Nano Mechatronics, vol. 5, no. 3-4, pp. 69-76, 2009.

Electrowetting-on-dielectric (EWOD)

- [15] H. Ukita, D. Liepmann H. Fujita, et al., "Micromechanical Photonics," Springer, Ch. 4, pp. 121-166, 2006.
- [16] Y.J. Liu, *et al.*, "Optically driven mobile integrated micro-tools for a lab-on-a-chip," *Actuators*, vol. 2, pp. 19-26, April 2013.
- [17] S. Maruo, A. Takaura, and Y. Saito, "Optically driven micropump with a twin spiral microrotor," *Optical Society of America*, vol. 17, no. 21, pp. 18525-18532, October 2009.
- [18] L. Kelemen, S. Valkai, and P. Ormos, "Integrated optical motor," *Applied Optics*, vol. 45, no. 12, pp. 2777-2780, April 2006.
- [19] S. Aryal, Analysis of electrokinetic flow in microfluidic chips, Youngstown State University, Thesis of Master of Science in Engineering, 2012.
- [20] N. Sasaki, T. Kitamori, and H.B. Kim, "Experimental and theoretical characterization of an AC electroosmotic micromixer," *Analytical Sciences*, vol. 26, pp. 815-819, July 2010.
- [21] S.H. Huang, S.K. Wang, H.S. Khoo, and F.G. Tseng, "AC electroosmotic generated in-plane microvortices for stationary or continuous fluid mixing," *14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems*, Lyon, France, pp. 1349-1352, 2007.
- [22] M. Campisi, D. Accoto, F. Damiani, and P. Dario, "A soft-lithographed chaotic electrokinetic micromixer for efficient chemical reactions in lab-on-chips," pp. 1-8, 2007.
- [23] B. Park, and S. Song, "Effects of multiple electrode pairs on the performance of a micromixer using dc-biased ac electro-osmosis," *Journal Of Micromechanics And Microengineering*, pp. 1-6, October 2012.
- [24] C.D. Chin, V. Linder, and S.K. Sia, *Commercialization of microfluidic point-of-care diagnostic devices*, Lab on a Chip, January 2012.

زيرنويسها

- Electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
 - ² Moore's law
 ³ Laminar
 - ⁴ Molecular diffusion

Lab-on-chip

- ⁵ Advection
- ⁶ Taylor dispersion
- ⁷ Active
- ⁸ Passive
- ⁹ Electrokinetics
- ¹⁰ Electroosmotic
- ¹¹ Electrophoresis
- ¹² Electric Double Layer (EDL)